



日本高分子学会的第 4 次 国际高分子会议在日本横滨召开

由日本高分子学会组织的第 4 次国际高分子会议,简称 IPC92,于 1992 年 11 月 29 日~12 月 3 日在日本横滨召开。作为纪念日本高分子学会成立 40 周年的活动之一,这一会议的主题是“在分子科学和技术上的新发展”。

参加会议的有来自世界各国的科学家、工程师,共计 541 人。我国有 9 位学者(包括台湾省 2 位)参加,美国代表 43 人,德国代表 11 人,韩国代表 21 人,法国代表 6 人,还有澳大利亚、英国、加拿大、比利时、捷克斯洛伐克、香港、意大利、俄罗斯、新加坡、瑞典和荷兰的代表。日本代表 440 人,占整个会议代表的 4/5。

本次大会最突出的一点是邀请了许多世界知名的高分子科学家与会,并就他们各自的研究领域作 40~45min 的报告。共有大会邀请报告 3 篇,它们是:(1)德国马克-普朗克高分子研究所 G. Wegner 的“先进高分子材料的分子设计和构筑学”;(2)日本九州大学 T. Kunitake 的“在双层横板和界面处二维聚合物的合成”;(3)美国道化学公司 F. P. Corson 的“21 世纪的高分子工业”会议安排了 76 篇分组邀请报告,分布为:高分子合成组 7 篇,功能高分子组 4 篇,高分子表征组 5 篇,聚合物结构与性能-固体、熔体和溶液组 7 篇,高性能聚合物组 5 篇,与生物有关的高分子组 4 篇;表面与界面专题 6 篇,含硅高分子专题 5 篇,液晶高分子专题 6 篇,高分子合金、共混物与复合材料专题 7 篇,电、磁、光学用聚合物专题 7 篇,可降解聚合物与回收专题 6 篇,高分子凝胶专题 4 篇,薄膜专题 3 篇。我国吉林大学的沈家骢作了题为“支化高分子薄膜中的组装”的邀请报告。近 80 篇的邀请报告都十分精彩,充分展示了近年来在分子化学、物理、物理化学及各类高分子材料领域中的最新研究成果与进展,并展望了今后几年以及下一世纪分子科学和技术的未来。

日本高分子学会组织的国际高分子会议是日本高分子学会最重要的活动之一,旨在促进世界各国间的国际科学交流。从 1984 年起已举办 4 次。

第 1 次 IPC 高分子科学与工程的最新发展,京都,1984 年

第 2 次 IPC 高性能特种高分子,东京,1986 年

第 3 次 IPC 膜与高分子界面现象,名古屋,1990 年

第 4 次 IPC 在分子科学和技术上的新发展,横滨,1992 年

这次的 IPC92 旨在促进分子科学与工程以及工业技术的发展。为时 4 天的会议给与会的各国科学家提供了面对面地讨论、交流的机会,也表现出日本高分子界的工作者们对国际分子科学和工程的影响在不断地扩大。

现在,日本高分子学会已开始筹办第 5 次国际分子会议,主题为“分子科学和技术的挑战”。预定 1994 年 11 月 29 日~12 月 3 日在日本大阪召开。会议内容包括:高分子合成和反应,高聚物结构与表征,聚合物的物理性质,高分子加工,功能高分子,高性能聚合物 6 个分组;及烯烃聚合物的新进展,高分子硅烷和含硅高分子,光学活性高分子,生物高分子和与生物有关的高分子,高分子体系的计算机模型化,高聚物的表面改性,高分子颗粒,光学用高分子等 8 个专题。

日本 IPC 举办之初还有一个目的是给日本的年轻学者提供一个机会,更多地与世界各国的高分子学者进行学术交流,促进国际合作。从这次到会的日本代表看,有相当大的比例是 20 多岁的年青人,他们不出国门就直接接触到了国际分子科学与工程的前沿,也在这个舞台上表现自己的能力。

(何嘉松)